

20 sierpnia 1925 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 1766.

Verein für chemische Industrie in Mainz
(Frankfurt n./M., Niemcy).

Kl. 22 h², 1/14

22h², 1/14

Politura.

Zgłoszono 27 marca 1920 r.

Udzielono 14 marca 1925 r.

Pierwszeństwo: 28 września 1914 r. (Niemcy).

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest politura do mebli i podobnych przedmiotów. Podczas gdy przy znanych politurach wypełnianie por i nadawanie połysku spełniały dwie rozmaite substancje, niniejszy wynalazek dotyczy w pierwszym rzędzie politury celulozowej, odpowiedniej dla każdego z obu zadań: wypełniania por i nadawania połysku. Politura składa się z rozczyну, zawierającego jedną lub kilka grup acetylowych, jednego lub więcej estrów celulozowych, który wszelkie środki, nadające gładkość, czyni zbyt zbytecznymi.

Tym sposobem uzyskuje się nie tylko widoczne korzyści co do prostoty zastosowania, lecz również i lepszą politurę. Jest nie tylko korzystnym, że ten sam materiał

może być użyty do uzupełnienia por i do właściwego politurowania, lecz i sama politura wykazuje wybitne właściwości, szczególnie przy użyciu octanu celulozowego. Właściwości te polegają na wyłączeniu oliwy i ewentualnie szkodliwych następstw jej zastosowania, doskonałym połysku, trwałości i dobrem przystosowaniu się do rozciągłości mokrego drzewa, a tem samem niezależności od temperatury i wpływów powietrza. Oprócz tego przylegają do niej znacznie mniej niż do innych politur obce ciała.

Politura jest nieprzemakalna i odporna na tłuszcz i zmaczana nie traci połysku. Dalsza cenna zaleta polega na tem, że politura nie potrzebuje być zastosowana, ani do rodzaju drzewa, ani do specjal-

nego środka ślizgowego, ani nie zawiera żadnego materiału napęniającego, który przebija się powoli przez politurę i niszczy jej połysk. Przytem politura ta wymaga znacznie mniejszej umiejętności przy jej nakładaniu niż politura szelakowa. Wszystkie opisane zalety nowej politury wypływają z jej zawartości octanu, a mianowicie: ester acetylowy może być w postaci octanu celulozowego lub jeżeli, jak przy celuloidzie, chodzi o inny ester celulozy, grupa acetylowa może się znajdować w rozpuszczalniku w postaci estru acetylowego, jak np. octanu metylowego lub octanu etylowego.

Nad zbliżoną znaną politurą z celuloиду, acetonu i spirytusu nowa politura wykazuje tę przewagę, że jest znacznie prostsza w użyciu. Szczególnie może praca z tą politurą być doprowadzona do końca bez przerwy, podczas gdy znana politura celuloidowa wymaga częstszej przerwy roboty, gdyż inaczej przykleja się tampon do polerowania.

Masa do polerowania może być w niektórych wypadkach uzupełniona dodatkiem żywicy.

Szczególnie przez użycie octanu celulozowego w zupełnym rozczynnie można uzyskać doskonałą politurę. Można ją rozcierać lekko i gładko zwykłymi narzędziami na powierzchni drzewa przy każdym jego rodzaju i wytworzona politura pokrywa szybko, wypełnia wszystkie pory, nie pęka i posiada niezwykle piękny połysk. Prawie bezbarwna politura nie ciemnieje później i może być dowolnie zabarwiona.

Politurę używa się w następujący sposób:

Po przygotowaniu przedmiotu, przeznaczonego do politurowania, powierzchnię jego smaruje się lub nasycza np. rozczynnem octanu celulozowego lub mieszaniną rozczynów octanowych z octanem celulozowym. Po wysuszeniu płaszczyzn ściera się je papierem szklanym lub innymi odpowiednimi środkami i następnie poleruje zapomocą tamponu, zwilżonego politurą lub jej rozczynnem, aż do ukazania się pożądanego lśniącego połysku.

W podobny sposób mogą być polerowane materiały zastępujące drzewo, papier, tekturę i podobne materiały. Zamiast rozczynów octanu celulozowego mogą być użyte inne rozczyny estrów celulozowych.

Bardzo odpowiednie rozczyny do polerowania są np. następujące:

7	części	octanu	celulozowego
52	"	"	metylowego
48	"	"	etylowego.

Zastrzeżenie patentowe.

Politura, znamienna tem, że składa się z rozczynu estru celulozowego, zawierającego jedną albo kilka grup acetylowych w rozpuszczalniku lub w rozpuszczonej substancji lub w obydwóch.

Verein für chemische
Industrie in Mainz.

Zastępca: Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.